**实验报告模板**

班级： 微电子学院 学号：PB21511897 姓名：李霄奕

1. 实验过程及本工艺的重点

PVD实验过程：

1. 检查 PVD 设备状态：确保机器运行正常
2. 参数设置：根据晶圆材料、加工要求选择不同的工艺参数
3. 上料：将晶圆送进设备
4. 设备开始作业：理片—预清洁—PVD—冷却
5. 下料：将晶圆从设备里拿出

CVD实验过程：

1. 检查 PVD 设备状态：确保机器运行正常
2. 参数设置：根据晶圆材料、加工要求选择不同的工艺参数
3. 上料：将晶圆送进设备
4. 设备开始作业：理片—预清洁—PVD—冷却
5. 下料：将晶圆从设备里拿出
6. 本工艺在集成电路生产过程中的作用

薄膜沉积能够通过物理或者化学手段将材料沉积在器件上，形成一层薄膜，用于生成器件结构或者作为牺牲层或者保护层

1. 详述本实验思考题中任何一个问题

Q：写出从四氯化硅生成硅的反应式

A：SiCl4+2H2==Si(多晶硅)+4HCl

1. 本实验存在的问题与建议

暂无